INK, INK-JET HEAD, PRINTER, AND WIRING BOARD

US

Patent number:

JP10204350

Publication date:

1998-08-04

Inventor:

USUI TAKAHIRO; FUKUSHIMA HITOSHI

Applicant:

SEIKO EPSON CORP

Classification:

- international:

B41J2/01; B41J2/045; B41J2/055; C09D11/00; H05K1/09; H05K3/10; B41J2/01; B41J2/045;

B41J2/055; C09D11/00; H05K1/09; H05K3/10; (IPC1-7):

C09D11/00; B41J2/01; B41J2/045; B41J2/055;

H05K1/09; H05K3/10

- european:

Y01N6/00

Application number: JP19970012904 19970127 **Priority number(s):** JP19970012904 19970127

Report a data error here

Abstract of JP10204350

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily form various fine wiring patterns and, as a result, shorten the lead time for production of a wiring board, by printing through discharging an ink containing metal particles having a sulfur compound adsorbed thereon using an ink-jet head composed of a cavity, a pressurizing device capable of causing a volume change of the cavity and a nozzle for discharging ink droplets. SOLUTION: Here, sulfur compound means a compound having one or more thiol functional groups or a disulfide compound. Such a sulfur compound is chemically adsorbed on the surface of metal particles when it is contacted with such particles in a solution or in a gaseous form, resulting in forming a monomolecular film having a structure similar to a two dimensional crystal. Through the use of this property of such a sulfur compound, an ink containing metal particles having a sulfur compound adsorbed thereon is discharged on a substrate by means of an ink-jet head to thereby form a fine wiring pattern. A low viscous ink which can be discharged by an ink-jet head is prepared by introducing a hydrophilic or hydrophobic group to the sulfur compound on the side opposite to a thiol group to impart hydrophilic or hydrophobic property and choosing an appropriate solvent.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号。

特開平10-204350

(43)公開日 平成10年(1998)8月4日

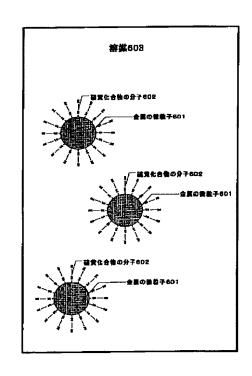
/E1\T_4 C1 8		金数 中国 121		FI							
(51) Int.Cl. ⁶		識別記号									
C09D	11/00			CO	9 D	11/00					
B41J	2/01			H0	5 K	1/09		Z			
	2/045					3/10		D			
	2/055			В4	1 J	3/04		101Z			
H05K	1/09							103A			
	2, 55		審查請求	未請求	請才	≷項の数15	OL	(全 8 頁)	最終頁に続く		
(21)出願番		特願平9-12904 (71)					1顧人 000002369				
						セイコ	ーエプ	ソン株式会社	<u>.</u>		
(22)出顧日		平成9年(1997)1月27日				-		西新宿2丁目	=		
		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(72)	発明						
				()	70711				番5号 セイコ		
								八州の1日の 式会社内	供5号 化十二		
				(70)	9/4/117 -			双冠红闪			
				(72)	光 明7	者福島 :	_				
									番5号 セイコ		
						ーエプ	ソン株	式会社内			
			•	(74)	代理》	人 弁理士	鈴木	喜三郎 ((外2名)		
				1							

(54) 【発明の名称】 インクとインクジェットヘッドと印刷装置と配線基板

(57)【要約】

【課題】従来の配線基板の製造方法では、微小な配線パ ターンを安価でかつ、短期間に製造できなかった。スク リーン印刷による方法では簡便に配線パターンを形成で きるが、微小な配線パターンの形成が困難であった。金 属膜をフォトリソ・エッチングする方法は微小な配線バ ターンを形成できるが、その製造費用は高価であり、製 造のリードタイムが長い。

【解決手段】硫黄化合物61が吸着した金属微粒子62 が、溶媒63中に存在するインクをインクジェットへッ ドによって基板上に吐出させ、インク中の溶媒等を乾燥 させることにより微細な配線パターンを自由に形成す る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】硫黄化合物が吸着した金属微粒子を含むと とを特徴とするインク。

【請求項2】キャビティとキャビティに体積変化を及ぼ す加圧装置と、ノズル部材に形成されたインク滴を吐出 せしめるノズルからインクジェットヘッドであって、請 求項1記載のインクを吐出せしめることを特徴とするイ ンクジェットヘッド。

【請求項3】請求項2記載のインクジェットヘッドによ と印刷装置。

【請求項4】請求項3記載の印刷装置により、請求項1 記載のインクを任意パターンで印刷することにより、形 成されることを特徴とする配線基板。

【請求項5】請求項2記載のキャビテイに体積変化を及 ぼす加圧装置が、圧電素子により形成されることを特徴 とするインクジェットヘッド。

【請求項6】請求項2記載のキャビテイに体積変化を及 ぼす加圧装置が、発熱素子により形成されることを特徴 とするインクジェットヘッド。

【請求項7】請求項1記載の金属微粒子が金微粒子をあ ることを特徴とするインク。

【請求項8】請求項1記載の硫黄化合物が下記の硫黄化 合物の混合物より成ることを特徴とするインク。

【請求項9】請求項1記載の硫黄化合物が下記の化学構 造式から成ることを特徴とするインク。

R1-S-S-R1

R1-SH

【請求項10】請求項8及び9記載の硫黄化合物のR1 が以下の化学構造式であることを特徴とするインク。 CnF2n+1-

【請求項11】請求項8及び9記載の硫黄化合物のR1 が以下の化学構造式であることを特徴とするインク。 CnF2n+1--- CmH2m---

【請求項12】請求項8及び9記載の硫黄化合物のR1 が以下の化学構造式であることを特徴とするインク。 HO2C (CH2)n-

【請求項13】請求項8及び9記載の硫黄化合物のR1 が以下の化学構造式であることを特徴とするインク。

【請求項14】請求項8及び9記載の硫黄化合物のR1 が以下の化学構造式であることを特徴とするインク。 HO3S (CH2)n-

【請求項15】請求項8及び9記載の硫黄化合物のR1 が以下の化学構造式であることを特徴とするインク。 H2N (CH2)n-

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術】本発明は印刷装置に関する。更に 詳しくは、インク滴を選択的に記録媒体に付着させるイ 50 て、401は基板、402は金属膜、403はレジスト

ンクジェットヘッドを用いた印刷装置と、それに用いら れるインクジェットヘッドとインクに関する。さらにと の印刷装置により形成された配線基板に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、電子機器等に用いられる配線基板 の製造量は飛躍的に増加している。これはコンピュー タ、通信、ネットワーク、マルチメデア等の発達が日本 のみならず、全世界的に急速に発展していることによ る。したがって、これらに用いられる電子機器の台数が り、請求項1記載のインクを基板に印刷することを特徴 10 単に増えるだけでなく、その種類も増えている。またそ れらに用いられる電子機器も日進月歩の勢いで高性能化 が加速し、それに用いられる配線基板の配線パターンも より微細化が要求されている。

> 【0003】との配線基板の製造は、基板上に金属ペー ストをスクリーン印刷する方法、あるいは基板上に金属 膜を形成し、その金属膜をフォトリソエッチングする方 法によって、形成されていた。

【0004】まず従来のスクリーン印刷による方法を図 3をもとに説明する。図3に於いて301は基板、30 20 2はスクリーンマスク、303は金属ペースト、304 はスキージを示す。図3は(1)基板、(2)スクリー ンマスクのセット、(3)金属ペーストの付与、(4) 金属ペーストの印刷、(5)スクリーンマスクの除去、 配線基板の完成の順に、スクリーン印刷による方法を示 す摸式断面図である。

(1)基板:

(2) スクリーンマスクのセット: 基板301上の所定 の位置にスクリーンマスク302をセットする。スクリ ーンマスク302には任意の配線パターンが形成されて 30 いる。

【0005】(3)金属ペーストの付与:スクリーンマ スク302の端に金属ペースト303を付与する。金属 ペースト303は金属の微粒子を樹脂及び溶剤に分散し たものである。

【0006】(4)金属ペーストの印刷:付与された金 属ペースト303を、スキージ304によりスクリーン マスク302上に引き延ばす。スキージ304の材質は 適度な柔らかさを持つシリコンゴム等が用いられる。ま たスキージ304を移動する速度は、配線パターンの大 きさ、金属ペースト303の流動性を考慮して決められ る。またその速度は一定である。

【0007】(5)スクリーンマスクの除去、配線基板 の完成:スクリーンマスク302を基板301から除去 すると、基板301上には金属ペースト303がスクリ ーンマスク302の配線パターン状に残る。これを乾 燥、焼成することにより、金属ペースト303の樹脂及 び溶剤成分が取り除かれ、配線基板が完成する。

【0008】次にフォトリソエッチングにより配線基板 を形成する方法を図4をもとに説明する。図4に於い

膜を示す。図4は(1)基板、(2)金属膜の形成、 (3)レジスト膜の形成、(4)レジスト膜の露光・現 像、(5)金属膜のエッチング、(6)レジスト膜の除 去、配線基板の完成の順に、スクリーン印刷による方法 を示す摸式断面図である。

(1)基板:

(2)金属膜の形成:基板401上に配線材料となる金 属膜402を形成する。金属膜402の形成は蒸着、ス パッタ等による乾式成膜法、またメッキ等による湿式成 膜法によられている。

【0009】(3) レジスト膜の形成:金属膜402上 にレジストをスピンコートあるいはロールコートにより 均一の厚さのレジスト膜403を形成する。レジストに はネガ型、ポジ型があるが、この場合はいずれも使用可

【0010】(4)レジスト膜の露光・現像:レジスト 膜403に図示されないフォトマスクをかいして、図示 されない露光機により露光する。レジスト膜403は露 光された部分が化学反応を起こし、ネガ型レジストは不 溶化し、ポジ型レジストは易溶化する。レジスト膜を現 20 像液に処理することによりレジスト膜403に配線パタ ーンが形成される。

【0011】(5)金属膜のエッチング:金属膜402 を適当なエッチャントでエッチングする。エッチングは 乾式法及び湿式法がある。

【0012】(6)レジスト膜の除去、配線基板の完 成:レジスト膜403を剥離液による溶解、あるいはア ッシングより除去し、配線基板を形成する。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、スクリ ーン印刷による方法では簡便に配線パターンを形成でき るが、微小な配線パターンの形成が困難であった。これ は配線パターンが微小化すると、図3のスクリーンマス ク302に形成された配線パターンに金属ペースト30 3が入りにくくなる。さらに入ったとしても、スクリー ンマスク302を除去する際に、金属ペースト303は 基板301上に残らず、配線パターンに留まってしま う。これは配線バターンの毛細管力が高くなっているこ とによる。近年は電子機器の小型化、高性能化の要求が 高まり、高集積化された微小な配線パターンの要求が高 40 まっている。そこで金属膜をフォトリソ・エッチングに より、微小な配線パターンを形成する方法が開発され た。この方法は微小な配線パターンを形成できるが、そ の製造費用は高価である。これはフォトマスク、露光 機、レジスト塗布装置等の製造設備が高価であり、これ **らをクリーンルームで設置しなければならない。またレ** ジストもスピンナー等で塗布すると、その使用効率が著 しく低い。結果として製造に要する費用は非常に髙価と なる。さらに前述したような複雑な製造工程を経る為、 製造のリードタイムが長いという課題がある。特にリー 50 、(アミノ)基を導入することで金属表面は親水化され

ドタイムが長い課題は、近年の商品開発が加速している 環境では企業の存続を左右する問題になっている。

[0014]

【課題を解決するための手段】本発明のインクとインク ジェットヘッドと印刷装置と配線基板は、かかる問題を 解決するために、金属の微粒子と硫黄化合物を含むイン クをインクジェットヘッドにより吐出する印刷装置によ り、配線基板を作成する。

[0015]

【発明の実施の形態】本発明は硫黄化合物と金属とが自 己吸着し、単分子膜を形成することを利用している。硫 黄化合物とは硫黄を含む有機物の中でチオール官能基を 1つ以上含む化合物又はジスルフィド化合物を総称する ものである。これら硫黄化合物は溶液中又は揮発条件 下、金基板表面上又は金微粒子表面に自発的に化学吸着 し、2次元の結晶構造に近い単分子膜を形成する。この 自発的化学吸着によって作られる分子膜を自己集合化 膜、自己組織化膜又はセルフアセンブリ膜と呼び、現在 基礎研究とともにその応用が注目されている。化学吸着 する基板表面は金だけでなく銀、銅、インジウム、ガリ ウムー砒素などの金属表面にも同様に自己集合化分子膜 を形成できる。との金属表面での硫黄原子の化学吸着の 反応メカニズムは完全には判明していないが硫黄化合物 が例えば金(0)表面にてAu(1)チオラート(RS-A u+)となって吸着する機構が考えられる。 金原子と硫黄 原子との結合はほぼ共有結合に近く(40−45 kcal/m ol)、非常に安定な分子膜が形成される。このような有 機分子の自己組織化は有機分子膜による固体表面機能化 技術として、光沢出し、潤滑、濡れ性、耐食、表面触媒 作用などの分野に拡張できる。又、分子素子、生物素子 などのマイクロエレクトロニクス及び、バイオエレクト ロニクス分野への応用が将来大いに期待されている。本 発明の骨子は硫黄化合物が吸着した金属微粒子を含むイ ンクをインクジェットヘッドによって基板上に吐出さ せ、微細な配線パターンを自由に形成できることであ る。また配線パターンの大きさははインクジェットへッ ドの吐出されるインクの体積で決定される。

【0016】次に本発明の請求項1記載のインクを図5 及び図6をもとに具体的に説明する。図5は金属微粒子 51の表面に硫黄化合物の分子52が吸着し、自己集合 化し、硫黄化合物の分子膜を形成することを示す模式図 である。また図6は複数の硫黄化合物61が吸着した金 属微粒子62が、溶媒63中に存在する状態を示す模式 図である。硫黄化合物の分子膜によって被覆された金属 微粒子の表面物性は分子膜先端にある官能基の性質によ って決定される。例えば、硫黄化合物の分子のチオール 基の反対側に親水性の請求項12記載のHO₂C (カル ボキシル) 基、請求項13記載のHO(水酸) 基、請求 項14記載のHO,S (スルホン酸)基、またはNH

る。同様に硫黄化合物の分子のチオール基の反対側に疎 水性の請求項10、11記載のフロロアルキル鎖を導入 することにより、疎水性有機溶媒、例えばオクタン、デ カンなどに溶融させて均一溶液を作る事が可能である。 これにより任意の溶媒をインクとして使用できる。溶媒 は印刷する配線基板に化学的損傷を与えなく、インクジ ェットヘッドで吐出可能な低粘度のものが選ばれる。例 として水、またエチルアルコール、イソプロピルアルコ ール等の低分子のアルコール、またデカン、オクタン等 の低分子の炭化水素等があげられるが、これらに特に限 10 定されるものではない。またインクには金の微粒子を安 定に分散させる、また配線基板との濡れ性をコントロー ルするために界面活性剤を添加してもよい。さらに配線 基板上で速やかにインクが個化するよう樹脂成分を添加

【0017】次に本発明の請求項2、6、7記載のイン クジェットヘッドを説明する。図1に請求項6の圧電素 子により動作するインクジェットヘッドの一例を示し、 その構造を説明する。図1はインクジェットヘッドの斜 おいて、101はノズル部材、102はノズル、103 は流路基板、104はキャビティ、105はリザーバ、 106は供給口、107はキャビテイ隔壁、108は振 動板、109は圧電素子、110はインクタンク口を示 す。インクは図示されないインクタンクからインクタン ク口110を介してリザーバ105に満たされる。リザ ーバ105は複数のキャビテイ104に供給口106を 介して接続され、インクをキャピテイ104に満たす。 複数のキャビテイ104はキャビテイ隔壁107により 分けられ、印字密度に対応する一定の間隔で配列され る。キャビテイ104は、流路基板103に刻まれた溝 にノズル部材101と振動板108に挟まれた構造とな る。振動板105には個々のキャビテイ104に対応し で圧電素子109が配接される。ノズル部材101には 個々のキャビテイ104に対応して、ノズル102が形 成されている。

【0018】次に図2を用いて図1のインクジェットへ ッドのインク滴の吐出動作を説明する。図2は図1の破 線A-Bによるインクジェットヘッドのキャビテイ及び リザーバ部分の断面図である。図2に於いて、201は 40 振動板、202は圧電素子、203は変形後の圧電素 子、204は変形後の振動板、205はリザーバ、20 6はキャビテイ、207はノズル、208はインク滴、 209はインクの流れを示す。インクは図示されないイ ンクタンクより、インクの流れ209の矢印の順にリザ ーバ205、キャビテイ206に満たされる。振動板2 01上に形成された圧電素子202に図示されない駆動 回路から、電気信号が送られると、圧電素子202は収 縮する。これにより、振動板201は変形後の振動板2 04の形状に変形する、また圧電素子202も変形後の 50 等が挙げられる。

圧電素子203の形状に変形する。この作用により、キ ャビテイ206の体積が減少し、キャビテイ206に満 たされたインクは圧力を受け、ノズル207に押し出さ れ、インク滴208となって吐出される。

【0019】次に図7に請求項7の発熱素子により動作 するインクジェットヘッドの一例を示し、その構造を説 明する。図7インクジェットヘッドの斜視図で、部分断 面により内部横造を示している。図7において、701 はノズル部材、702はノズル、703は流路基板、7 04はキャビテイ、705はリザーバ、706は供給 口、707はキャビティ隔壁、708は発熱素子基板、 709は発熱素子、710はインクタンク口を示す。イ ンクは図示されないインクタンクからインクタンク口7 10を介してリザーバ705に満たされる。リザーバ7 05は複数のキャビテイ704に供給口706を介して 接続され、インクをキャビティ704に満たす。複数の キャビテイ704はキャビテイ隔壁により分けられ、印 字密度に対応する一定の間隔で配列される。キャビティ 704は、流路基板703に刻まれた溝にノズル部材7 視図で、部分断面により内部横造を示している。図1に 20 01と発熱素子基板708に挟まれた構造となる。発熱 素子基板705には個々のキャビテイ704に対応して 発熱素子709が配接される。ノズル部材701には個 々のキャピテイ704に対応して、ノズル702が形成 されている。発熱素子709に図示されない駆動回路よ り、電気信号が送られると発熱する。インクが気化し、 気泡が発生する。この気泡によりインクがノズル702 から吐出する。

> 【0020】次に本発明の請求項3記載の印刷装置を図 8をもとに説明する。ステージ上に所定の位置に基板が 30 置かれる。基板の上にガイド軸が置かれ、このガイド軸 上にインクジェットヘッドが置かれる。インクジェット ヘッドはガイド軸上を図示されない制御回路により、矢 印の方向に移動できる。また、ガイド軸も同様に図示さ れない制御回路により、矢印の方向に移動できる。これ によりインクジェットヘッドは基板上の任意の位置に移 動でき、インクを吐出できる。したがって本発明のイン クをこの印刷装置で吐出することにより、任意の配線バ ターンを形成できる。また、インクジェットヘッドを固 定して、ステージを任意の位置に移動する構造の印刷装 置でもよい。

【0021】次に本発明の請求項4記載の配線基板を説 明する。配線基板は前述の印刷装置により、任意のバタ ーンにインクを吐出されている。インクには溶媒等の液 体成分がある為、乾燥する必要がある。乾燥方法は特に 限定されるものではなく、発熱体による乾燥機、光照射 式の乾燥機、電磁波照射式の乾燥機等が使用できる。配 線基板の材質は、前述の溶剤の乾燥時の温度に耐え、溶 剤に対する耐性があればよく、特に限定されるものでは ない。例として、シリコン、ガラス、プラスチック樹脂

【図面の簡単な説明】

【図1】圧電素子により動作するインクジェットヘッド の構造を説明する斜視図。

【図2】インクジェットヘッドのインク滴の吐出動作を 説明する断面図。

【図3】スクリーン印刷による配線基板の形成を示す模 式図。

【図4】フォトリソエッチングによる配線基板の形成を 示す模式図。

【図5】金属の微粒子に硫黄化合物の分子が吸着した状 10 態を示す模式図。

【図6】硫黄化合物が吸着した金属微粒子が溶媒中に存 在する状態を示す模式図。

【図7】発熱素子により動作するインクジェットヘッド の構造を説明する斜視図。

【図8】印刷装置の斜視図。

【符号の説明】

101・・・ノズル部材

102・・・ノズル

103・・・流路基板

104・・・キャビティ

105・・・リザーバ

106・・・供給口

107・・・キャビティ隔壁

108・・・振動板

109・・・圧電素子

110・・・インクタンク口

201・・・振動板

202・・・圧電素子

203・・・変形後の圧電素子

204・・・変形後の振動板

205・・・リザーバ

206・・・キャビティ

*207・・・ノズル

208・・・インク滴

209・・・インクの流れ

301 · · · 基板

302・・・スクリーンマスク

303・・・金属ペースト

304・・・スキージ

401 · · · 基板

402・・・金属膜

404・・・レジスト膜

501・・・金属の微粒子

502・・・硫黄化合物の分子

601・・・金属の微粒子

602・・・硫黄化合物の分子

603 · · · 溶媒

604・・・金層

701・・・ノズル部材

702・・・ノズル

703・・・流路基板

20 704・・・キャビテイ

705・・・リザーバ

706 · · · 供給口

707・・・キャビティ隔壁

708・・・発熱素子基板

709・・・発熱素子

710・・・インクタンクロ

801・・・インクジェットヘッド

802・・・ガイド軸

803 · · · 基板

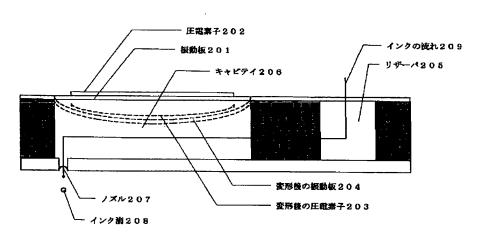
30 804・・・ステージ

805・・・インクジェットヘッドの動きを示す矢印

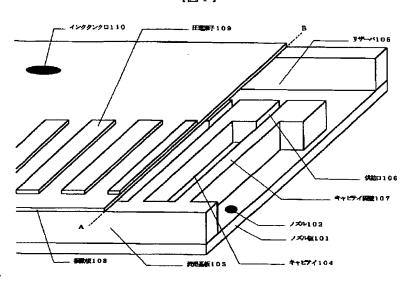
806・・・ガイド軸の動きを示す矢印

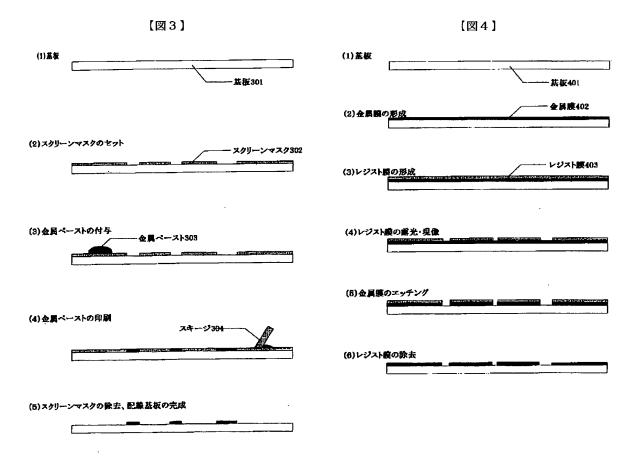
*

【図2】

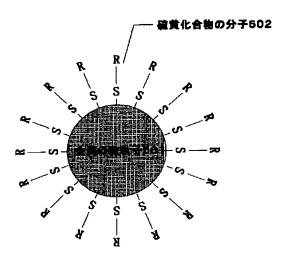


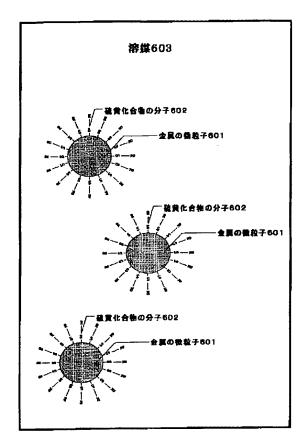
【図1】





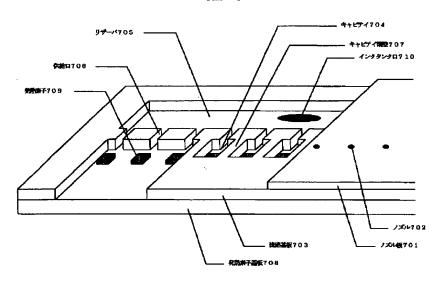
【図5】



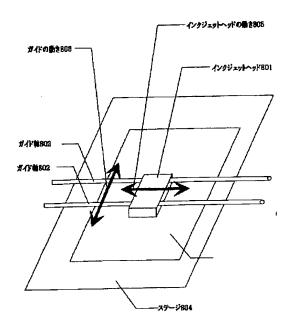


【図6】

【図7】



【図8】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁶

識別記号

FΙ

H 0 5 K 3/10